

放射光利用ナノテク最前線
Nanotechnology 2006**参加無料**
定員200名

※定員になり次第締切とさせていただきます。

日時 平成18年6月23日(金) 10:00~17:30

場所 コクヨホール

〒108-8710 東京都港区港南1丁目8番35号

TEL 03-3450-3712 URL http://www.kokuyo.co.jp/service/kokuyohall/srs_top.html

■主催 財団法人 高輝度光科学研究センター、独立行政法人 日本原子力研究開発機構、独立行政法人 物質・材料研究機構、立命館大学

■後援 (社)応用物理学会、(社)日本化学会、(社)日本物理学会、(社)日本分析化学会、ナノ学会、日本結晶学会、日本表面科学会、日本放射光学会 (50音順)

プログラム

P R O G R A M

- 10:00~10:05 開会挨拶
- 10:05~10:15 「ナノテクノロジー総合支援プロジェクトの現状と今後」
- 10:15~10:55 招待講演
「計算機ナノマテリアルデザイン:デザインと実証」
- 10:55~11:35 招待講演
「イオン散乱・光電子分光によるSiC表面初期反応過程の研究」
- 11:35~12:00 研究成果報告
「LIGAプロセスを用いたアクリル樹脂基板上への微細形状パターニング技術の確立」
- 12:00~12:25 研究成果報告
「NEXAFSによる液晶配向膜・液晶分子配向の研究」
- 12:25~14:30 休憩 / 研究成果ポスター発表
- 14:30~15:10 招待講演
「硬X線光電子分光法を用いたLSIメタルゲート電極における仕事関数変調メカニズムの解明」
- 15:10~15:35 研究成果報告
「10T高磁場下のMCD測定によるDy,Er内包フラーレンの磁化測定」
- 15:35~16:00 研究成果報告
「高密度・高均一InAs量子ドットの自己形成とその場時間分解X線回折測定」
- 16:00~16:10 休憩
- 16:10~16:35 研究成果報告
「ナノメータオーダーの合金粒子の異常X線小角散乱」
- 16:35~17:00 研究成果報告
「SPELEEMによるIn/Si(111)上でのSb成長過程の観察」
- 17:00~17:25 研究成果報告
「金属表面における水分子の吸着構造」
- 17:25~17:30 閉会挨拶

米倉 実

ナノテク支援センター
副センター長

吉田 博

大阪大学 産業科学研究所

城戸 義明

立命館大学 理工学部

黒川 正也

スターライト工業 (株)

木村 慎一

JSR (株)

吉木 昌彦

(株)東芝 研究開発センター

北浦 良

名古屋大学大学院 理学研究科

山口 浩一

電気通信大学 電気通信学部

鈴木 茂

東北大学 多元物質科学研究所

安江 常夫

大阪電気通信大学 エレクトロニクス基礎研究所

中村 将志

千葉大学 工学部

参加費 無料

定員 200名

※定員になり次第締切とさせていただきます。

参加申込方法

■E-mailまたはFAXでのお申し込みの場合

氏名、所属、部署、住所(連絡先)、電話番号、FAX番号、E-mailを
ご記入のうえ、下記参加登録事務局まで送付ください。

■WEBからのお申し込みの場合

下記SPRING-8 WEBの放射光グループ研究成果報告会参加申込
登録画面からお申し込みください。参加登録事務局
問い合わせ先

(財)高輝度光科学研究センター 研究調整部

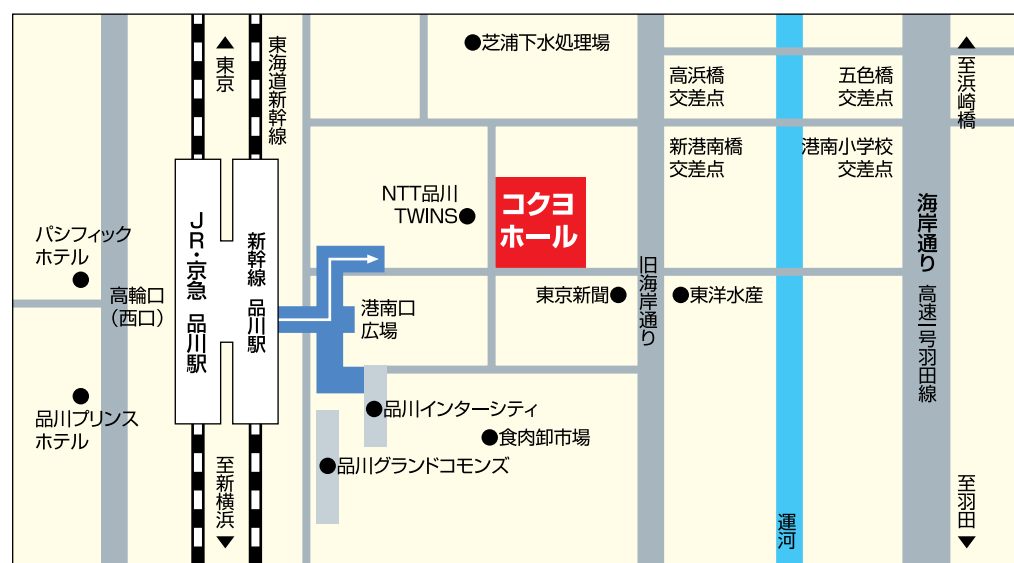
ナノテクノロジー総合支援プロジェクト推進室 放射光グループ事務局
三好(ミヨシ)、徳永(トクナガ)

TEL 0791-58-0919 FAX 0791-58-0830

E-mail nano_tech@spring8.or.jp

URL http://www.spring8.or.jp/ext/ja/nano_tech/result05/

交通のご案内



電車

●JR・京急「品川駅」下車
港南口(東口)より徒歩2分

飛行機

●羽田空港から京急線に乗り換えて「品川駅」下車
港南口(東口)より徒歩2分